ダイヤモンド中NVセンターを用いた 量子センシング

Keio University



慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 スピントロニクス研究センター

早瀬潤子







量子コヒーレンスや量子もつれを制御・活用







ein Universit

量子センサの最有力「ダイヤモンドNVセンター」

電子スピンの量子状態変化から物理量を高感度・高空間分解能に測定する



ダイヤモンドNVセンター







✓ 室温で安定な局在電
 子スピンの量子状態
 ✓ 外場による量子状態
 変化を測定

光・マイクロ波による 量子状態初期化・制御



・ 1997年の再発見を皮切りに, 室温・大気圧下で動作する量子センサ開発が急速に進展.

A. Gruber, et al., Science, 276, 2012 (1997).





高感度・高空間分解能、室温・大気圧下で動作



感度以外の性能は十分.感度もまだ改善の余地あり.

Figures: フランスサクレー大学, Nat. Phys, (2007). 村田製作所HP, 参考:荒井慧悟(東工大), 量子技術セミナー資料 5

ダイヤモンドNVセンター量子センサの長所

ダイヤモンド量子センサは他にはない優れた特徴をもつ



デバイス・生体計測など幅広い分野への応用.基礎科学の発展にも寄与.

[1] Appl. Phys. Lett. (2018). [2] Nat. Phys. (2011). [3] Science (2019). [4] Nature (2013). [5] Nat. Commun. (2019). [6] Science (2019). [7] Nature (2013). , 参考:荒井慧悟(東工大),量子技術セミナー資料

Keio University

ダイヤモンドNVセンター量子センサの長所

ダイヤモンド量子センサは他にはない優れた特徴をもつ



デバイス・生体計測など幅広い分野への応用.基礎科学の発展にも寄与.

[1] Appl. Phys. Lett. (2018). [2] Nat. Phys. (2011). [3] Science (2019). [4] Nature (2013). [5] Nat. Commun. (2019). [6] Science (2019). [7] Nature (2013). , 参考:荒井慧悟(東工大),量子技術セミナー資料







ダイヤサンプル作製

ダイヤ結晶成長,イオン注入・電子線照射,同位体制御,ドーピング, 位置制御,配向制御,微細加工(ピラー・レンズ加工),光共振器構造, 表面処理・修飾など

量子状態制御技術(量子計測プロトコル)

電子スピン量子制御,核スピン量子制御など 周波数特性制御,感度向上,ノイズ除去



装置開発

光学系設計(共焦点,イメージング),MW・RF照射系設計(アンテナ,信号制御), 磁場印加系,AFM系,生体計測系,計測プログラミングなど.

計測・信号処理技術

雑音除去 (コモンモード作動検出, ロックイン検出) など



機械学習,データ推定など.



小型化,モバイル化,プローブ作製など.





ダイヤサンプル作製

ダイヤ結晶成長,イオン注入・電子線照射,同位体制御,ドーピング, 位置制御,配向制御,微細加工(ピラー・レンズ加工),光共振器構造, 表面処理・修飾など

量子状態制御技術(量子計測プロトコル)

電子スピン量子制御,核スピン量子制御など 周波数特性制御,感度向上,ノイズ除去

量子物理 解明

装置開発

光学系設計(共焦点,イメージング),MW・RF照射系設計(アンテナ,信号制御), 磁場印加系,AFM系,生体計測系,計測プログラミングなど.

計測・信号処理技術

雑音除去(コモンモード作動検出, ロックイン検出)など

インフォマティクス

機械学習,データ推定など.



小型化,モバイル化,プローブ作製など.

- 1. イントロダクション~量子センサへの期待~
- 2. ダイヤモンドNVセンター量子センサの原理
- 3. 研究紹介~スピン量子状態制御とセンシング~
 - 多周波数MWによる電子スピン同時制御とベクトルAC磁場 センシングへの応用
 - MW+RFによる電子スピン多重共鳴とCW-ODMRによる AC磁場・温度センシングへの応用
- 4. 研究紹介~ダイヤモンドサンプル作製~
 - ・ 窒素ドープ同位体制御CVD成長によるNV生成
 - (100)基板微細加工+CVD成長によるNV位置・配向制御

1. イントロダクション〜量子センサへの期待〜

2. ダイヤモンドNVセンター量子センサの原理

- 3. 研究紹介~スピン量子状態制御とセンシング~
 - 多周波数MWによる電子スピン同時制御とベクトルAC磁場 センシングへの応用
 - MW+RFによる電子スピン多重共鳴とCW-ODMRによる AC磁場・温度センシングへの応用
- 4. 研究紹介~ダイヤモンドサンプル作製~
 - 窒素ドープ同位体制御CVD成長によるNV生成
 - (100)基板微細加工+CVD成長によるNV位置・配向制御



量子センサの最有力「ダイヤモンドNVセンター」 電子スピンの量子状態変化から物理量を高感度・高空間分解能に測定する

ダイヤモンドNVセンター



発光による量子状態読み出し



 ✓ 電子スピンが局在(三重項状態)
 ✓ 室温にて単一電子スピンからのナノスケール 発光を観測可⇒高空間分解能
 ✓ スピン量子状態に依存した発光

レーザー共焦点顕微鏡を用いて比較的容易にスピン量子状態の読み出しが可能.



A. Gruber, et al., Science 276, 2012 (1997).; G. Balasubramanian, et al., Nature, 8, 383 (2008).







外場によるスピン量子コヒーレンス(重ね合わせ状態)の変化を測定

- ✓ 単一周波数MWで2準位系の重ね合わ せ状態を制御
- ✓ 重ね合わせ状態の量子力学的な位相
 に外場情報を蓄積

⇒**高感度化**が可能.

✓ 重ね合わせ状態が保たれている必要.



量子状態制御法が量子センサ性能(感度や周波数特性など)を決める.

種々の量子状態制御法(CW or パルス制御)

量子状態制御法が量子センサ性能(感度や周波数特性など)を決める



E. V. Levinel, et al., Nanophotonics, 8, 1945 (2019).

Keio University

1. イントロダクション〜量子センサへの期待〜

- 2. ダイヤモンドNVセンター量子センサの原理
- 3. 研究紹介~スピン量子状態制御とセンシング~
 - 多周波数MWによる電子スピン同時制御とベクトルAC磁場 センシングへの応用
 - MW+RFによる電子スピン多重共鳴とCW-ODMRによる AC磁場・温度センシングへの応用
- 4. 研究紹介~ダイヤモンドサンプル作製~
 - ・ 窒素ドープ同位体制御CVD成長によるNV生成
 - (100)基板微細加工+CVD成長によるNV位置・配向制御

1. イントロダクション〜量子センサへの期待〜

- 2. ダイヤモンドNVセンター量子センサの原理
- 3. 研究紹介~スピン量子状態制御とセンシング~
 - 多周波数MWによる電子スピン同時制御とベクトルAC磁場 センシングへの応用
 - MW+RFによる電子スピン多重共鳴とCW-ODMRによる AC磁場・温度センシングへの応用
- 4. 研究紹介~ダイヤモンドサンプル作製~
 - ・ 窒素ドープ同位体制御CVD成長によるNV生成
 - (100) 基板微細加工 + CVD成長によるNV位置・配向制御

NV配向とベクトルAC磁場センシング











 $\boldsymbol{e}_2 \| [\overline{1}\overline{1}\overline{1}1] \|$

NV3









*f***1** with *B***_{DC}**





 $e_1 \| [111]$



NV3







 $\boldsymbol{e}_2 \| [\overline{1}\overline{1}\overline{1}1] \|$





 $e_1 \| [111]$



 $\boldsymbol{e}_2 \parallel \begin{bmatrix} \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \end{bmatrix}$

NV3





NV4



with $\pmb{B}_{\rm DC}$







NV3











 $B_{NV4} = \boldsymbol{B}_{AC} \cdot \boldsymbol{e_4}$







BACによる

発光変化

(信号)







NV4

B_{AC}により変化しない発光 (ノイズ)







S. Kitazawa, et al., Phys. Rev. A 96, 042115 (2017).; K. Yahata, et al., Appl. Phys. Lett. 114, 022404 (2019).









多周波数MWによるベクトルAC磁場センシング(実験)





1. イントロダクション〜量子センサへの期待〜

- 2. ダイヤモンドNVセンター量子センサの原理
- 3. 研究紹介~スピン量子状態制御とセンシング~
 - 多周波数MWによる電子スピン同時制御とベクトルAC磁場 センシングへの応用
 - MW+RFによる電子スピン多重共鳴とCW-ODMRによる AC磁場・温度センシングへの応用
- 4. 研究紹介~ダイヤモンドサンプル作製~
 - 窒素ドープ同位体制御CVD成長によるNV生成
 - (100)基板微細加工+CVD成長によるNV位置・配向制御



CW-ODMR



J. M. Taylor, et al., Nat. Phys. 4, 810(2008).



パルスODMR (スピンエコーなど)

電子スピンの固有状態(平行 or 垂直バイアス磁場)





電子スピン二重共鳴によるRF-Dressed状態の生成





S.Saijo, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **113**, 082405 (2018).; T. Yamaguchi, *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **58**, 100901(2019).; T. Yamaguchi, *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **59**, 110907 (2020).

微細回路の交流磁場/電流イメージングへの応用





CW-ODMRでマイクロスケールの微細回路磁場/電流を非接触にイメージ可能.

S.Saijo, et al., Appl. Phys. Lett. 113, 082405 (2018).; Karl J. Hallbäck, et al., Proc. SPIE. 117004A (2021).

電子スピン三重共鳴によるRF-Double-Dressed状態の生成



Keio University

電子スピン三重共鳴によるRF-Double-Dressed状態の生成

Kein University

RF-Dressed状態生成による線幅減少

C. S. Shin, et al., Phys. Rev. B 88, 161412 (2013).; H. Tabuchi, et al., arXiv:2205.06976 (2022).

RF-Dressed状態生成による温度感度向上

RF-Dressed状態を用いた交流磁場・温度複合センシング

2点測定による交流磁場・温度複合センシング

設定値	実測値
$\Delta T = 0.2 \text{ K}$	$\Delta T = 0.2823 \text{ K}$
$\Delta B_{ACZ} = 0.200 \text{ Vpp}$	$\Delta B_{ACZ} = 0.2598 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.2 \text{ K}$	$\Delta T = 0.2187 \text{ K}$
$\Delta B_{ACZ} = 0.600 \text{ Vpp}$	$\Delta B_{ACZ} = 0.6236 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.2 \text{ K}$ $\Delta B_{ACZ} = 0.800 \text{ Vpp}$	$\Delta T = 0.3146 \text{ K}$ $\Delta B_{ACZ} = 0.8281 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.4 \text{ K}$ $\Delta B_{\text{ACZ}} = 0.200 \text{ Vpp}$	$\Delta T = 0.3961 \text{ K}$ $\Delta B_{ACZ} = 0.2542 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.4 \text{ K}$	$\Delta T = 0.4584 \text{ K}$
$\Delta B_{ACZ} = 0.400 \text{ Vpp}$	$\Delta B_{ACZ} = 0.4632 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.4 \text{ K}$	$\Delta T = 0.4273 \text{ K}$
$\Delta B_{ACZ} = 0.800 \text{ Vpp}$	$\Delta B_{ACZ} = 0.8279 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.8 \text{ K}$	$\Delta T = 0.6917 \text{ K}$
$\Delta B_{ACZ} = 0.200 \text{ Vpp}$	$\Delta B_{ACZ} = 0.2383 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.8 \text{ K}$	$\Delta T = 0.736 \text{ K}$
$\Delta B_{ACZ} = 0.600 \text{ Vpp}$	$\Delta B_{ACZ} = 0.699 \text{ Vpp}$
$\Delta T = 0.8 \text{ K}$	$\Delta T = 0.7364 \text{ K}$
$\Delta B_{\text{ACZ}} = 1.000 \text{ Vpp}$	$\Delta B_{ACZ} = 1.0503 \text{ Vpp}$

弱RF下における電子スピン二重共鳴現象の周波数特性

✓ 周波数特性は2周波に対するRabiの理論と一致

S.Saijo, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **113**, 082405 (2018).; T. Yamaguchi, *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **58**, 100901(2019).; T. Yamaguchi, *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. **59**, 110907 (2020).

強RF下における電子スピン二重共鳴現象の周波数特性

実験結果 (7 Vpp)

数値計算結果 (146 μT)

✓ 弱励起下の理論では説明できないアンチクロス構造が出現.
 ✓ RF多光子過程(フロケ理論)で説明可能.
 ✓ 微小な平行磁場印加により本来現れないRF2光子過程が許容に.

1. イントロダクション〜量子センサへの期待〜

- 2. ダイヤモンドNVセンター量子センサの原理
- 3. 研究紹介~スピン量子状態制御とセンシング~
 - 多周波数MWによる電子スピン同時制御とベクトルAC磁場 センシングへの応用
 - MW+RFによる電子スピン多重共鳴とCW-ODMRによる AC磁場・温度センシングへの応用
- 4. 研究紹介~ダイヤモンドサンプル作製~
 - 窒素ドープ同位体制御CVD成長によるNV生成
 - (100)基板微細加工+CVD成長によるNV位置・配向制御

窒素ドープ同位体制御CVDダイヤ成長によるNV生成

H. Watanabe, *et al.*, J. Appl. Phys. **105**, 093529 (2009). T. Ishikawa *et al.*, Nano Lett. **12**, 2083 (2012).

溝構造(100)基板上CVD成長によるNV選択生成

H. Watanabe, et al., IEEE Trans. on Nanotech.15, 614 (2016).

溝構造(100)基板上CVD成長によるNV配向制御

H. Watanabe, et al., IEEE Trans. on Nanotech.15, 614 (2016).

{111}逆面ピラミッド構造上CVD成長によるNV配向制御

M. Nagai, et al., Sci. Rep. 8, 6687 (2018).

H. Ishiwata, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **111**, 043103 (2017).K. Tahara, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **107**, 193110 (2015).

おわりに

- 1. スピン量子状態制御とセンシング
 - 多周波数MWによる電子スピン同時制御とベクトルAC磁場 センシングへの応用
 - MW+RFによる電子スピン二重共鳴とCW-ODMRによる AC磁場・温度センシングへの応用
- 2. ダイヤモンドサンプル作製
 - ・ 窒素ドープ同位体制御CVD成長によるNV生成
 - (100)基板微細加工+CVD成長によるNV位置・配向制御
- ✓ ダイヤモンドNVセンターを用いた固体量子センサは、室温・大気
 圧下で動作する社会実装可能な量子センサの有力候補であり、幅
 広い分野で革新をもたらすことが期待される.さらなる研究開発の加速が求められる.

慶應義塾大学 早瀬研究室 伊藤研究室,門内博士 スピントロニクス

研究センター

Science of Hybrid Quantum Systems

Q-LEAP 量子計測・センシング

NIM

情報通信研究機構(NICT) 赤羽博士 物質·材料研究機構 (NIMS) 寺地博士

